高純度Ptfe酸蒸気洗浄システム

微量分析用実験器具除染装置（漏れ防止密閉還流技術、カスタマイズ可能なマルチポジション容量）

商品番号: PL-CP113

前書き

この高純度PTFE酸蒸気洗浄システムで、微量分析のワークフローを最適化してください。漏れ防止のクローズドループ設計により、大幅な酸の節約と優れた除染効果を実現。カスタマイズ可能なこの装置は、高感度なICP-MSおよびICP-OESラボアプリケーション向けに超低バックグラウンドレベルを保証します。

詳細を学ぶ

用途	説明	主な利点
微量金属分析	ICP-MSおよびICP-OESのサンプル前処理に使用されるTFMおよびPFA分解容器の除染。	PPTおよびPPB検出のための超低バックグラウンドレベルを達成。
半導体製造	微量な表面汚染物質を除去するためのPFAウェハキャリアおよび流体ハンドリング部品の洗浄。	高純度製造プロセスにおける金属汚染を防止。
地球化学研究	鉱物溶解および同位体分析に使用されるテフロンるつぼおよび分解管のディープクリーニング。	感度の高い同位体および鉱物学的測定において高い精度を保証。
環境モニタリング	重金属試験前の土壌および水質サンプル容器の大量自動洗浄。	厳格な品質管理を維持しながら、ラボのスループットを向上。
臨床・製薬	感度の高い生物学的研究や薬物代謝研究に使用されるPFAバイアルおよびピペットの洗浄。	敏感な医療サンプルバッチ間のクロスコンタミネーションを排除。
原子力工学	放射性物質や腐食性物質の分析に使用される特殊なフッ素樹脂製実験器具の除染。	危険な試薬を取り扱うための安全で密閉された環境を提供。

パラメータ	PL-CP113の仕様
製品番号	PL-CP113
主要構造材料	高純度バージンPTFE / PFA
洗浄メカニズム	酸蒸気還流 / サブボイリング蒸気洗浄
対応試薬	HNO3, HCl, HF, およびその他の高純度酸
処理能力	26ポジション（標準） / 完全カスタマイズ可能
密封方法	ネジ式およびガスケットによる漏れ防止シール
耐熱性	最大200°Cまでの連続運転（材料による制限あり）
カスタマイズオプション	チャンバー寸法、ラック形状、チューブ径
制御システム	外部PID温度コントローラーに対応
製造工程	エンドツーエンドの精密CNC加工